

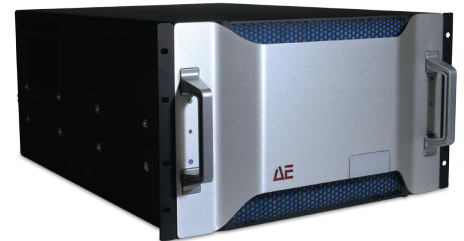
2013年, AE® 通过采用双极性脉冲直流技术为双极磁控溅射带来了新的技术革新, 提供了前所未有的等离子体控制技术。Ascent AP电源在紧凑的单/双极磁控溅射方案中引入了额外的控制参数, 使得功率输出更加优化。Ascent AP具有专利的脉冲技术, 可以主动抑制电弧, 其广泛的工作范围使得该电源可以应用于许多材料, 拓展了制程的灵活性以及材料的不断创新。

### 特点

- › 输出波形可自定义, 满足多种功率输出要求
- › 专利脉冲技术可以抑制消除电弧, 保证更高功率输出, 提高产能
- › 紧凑型单机解决方案 (最大 30 kW)
- › Set point compensation™ 技术确保稳定的功率输出
- › 应用于各种制程材料的广泛工作范围

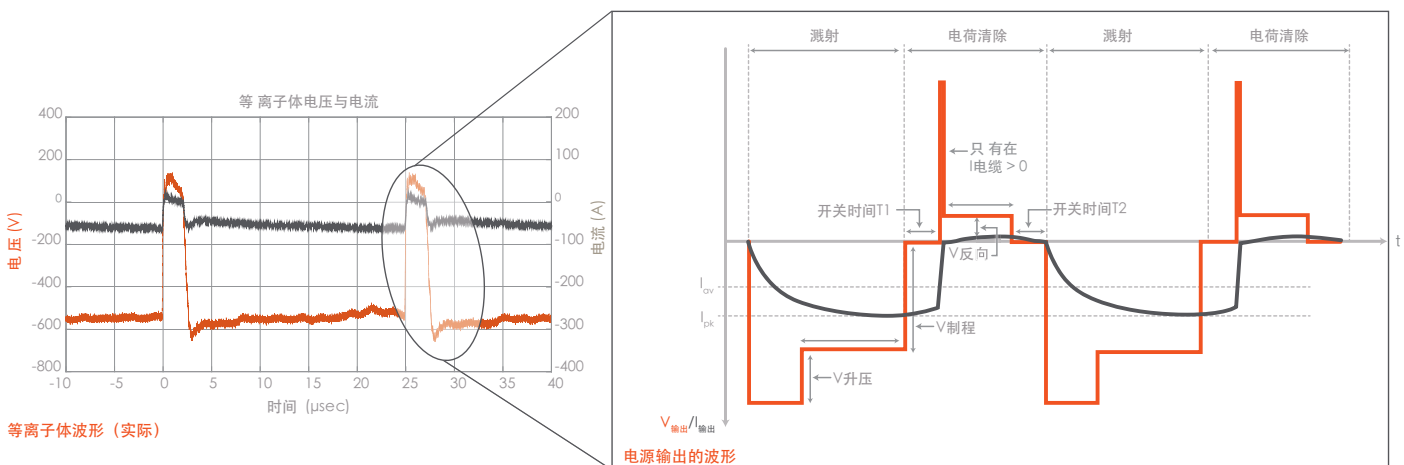
### 优势

- › 电介质膜和导电膜的精准溅射
- › 提供单磁控和双磁控配置
- › 增加制程控制的灵活性与创新性
- › 高性能的薄膜质量和产量
- › 镀膜重复性好, 且满足多项定制要求
- › 更高功率等级, 更少电弧损坏
- › 易于集成与控制



### 反应式及导电性材料的单靶磁控溅射

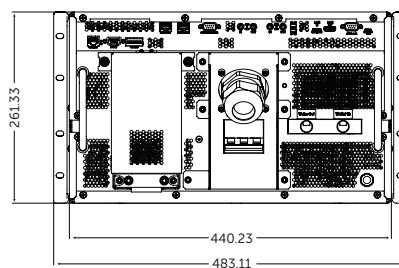
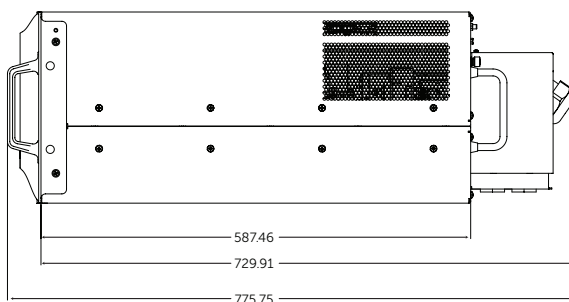
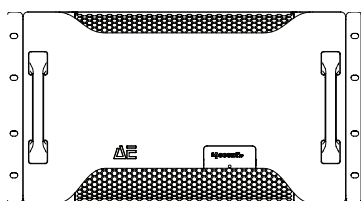
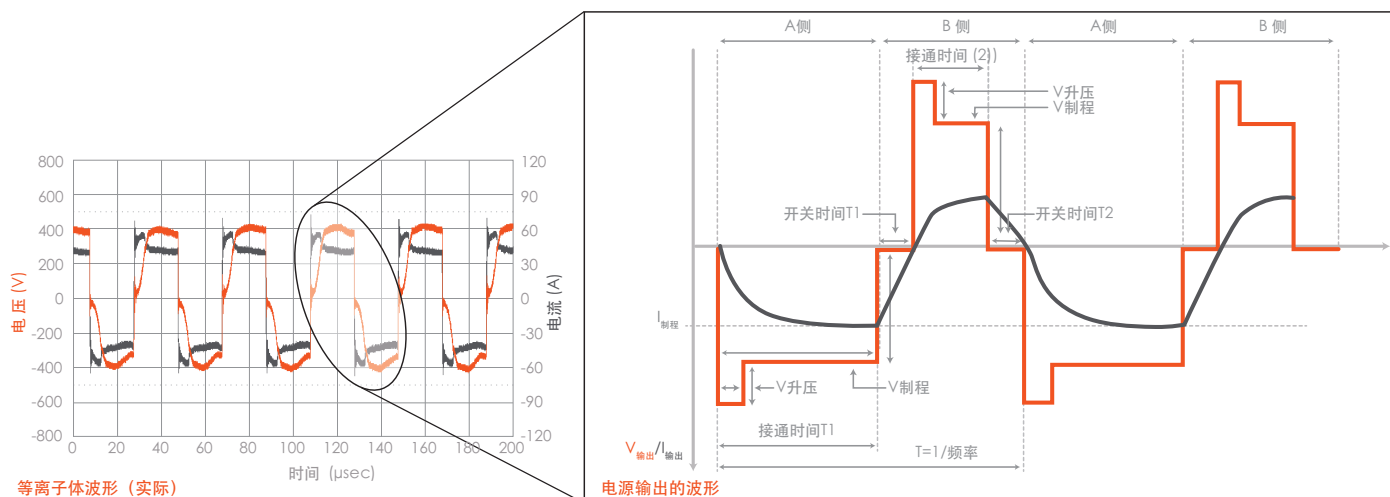
- › 作为单靶磁控溅射电源或偏压电源使用



与正弦波中频交流电源相比较, 具有专利技术的升压电路加载在溅射波形的上升沿保证了功率的加速输出。对波形的反向部分进行最大限度的控制, 保证在反向阶段更加彻底的清除电荷。

## 双靶磁控反应溅射和“双材料掺杂共溅射”

独立控制电源输送至每个磁控靶管，以提高沉积速率和靶材利用率。



	ASCENT® SMS AP电源	ASCENT® DMS AP电源
电源	30 kW (15 kW)	30 kW (15 kW)
电压	1000 VDC	1000 VDC
峰值电流	100 A (50 A)	无
均值电流	75 A (38 A)	75 A (38 A)
频率	0.5 至 150 kHz	0.5 至 150 kHz
反向时间 (最大值)	15 μsec	无
工作周期	> 60% 开启时间	5 至 95%
反向电压	300 VDC 最大值	无
脉冲配置	单极	双极